

變更高雄市大坪頂以東地區都市計畫
(和發產業園區)細部計畫(土地使用分區管
制)案

高雄市政府

中華民國 111 年 9 月

高雄市變更都市計畫審核摘要表

項 目	說 明	
都市計畫 名稱	變更高雄市大坪頂以東地區都市計畫(和發產業園區)細部計畫(土地使用分區管制)案	
變更都市計畫 法令依據	「都市計畫法」第 27 條第 1 項第 3 款	
變更都市計畫 機關	高雄市政府	
自擬細部計畫 或申請變更都 市計畫之機關 名稱或土地權 利關係人姓名	高雄市政府經濟發展局	
公開座談會	本案因無涉及取得私有土地，符合「都市計畫草案辦理公開展覽前應行注意事項」第四點第(一)目但書規定，故免辦理座談會。	
本案公告及公 開展覽之起訖 日期	公開展覽	
	公 開 說 明 會	
人民團體對本 案之反映意見		
本案提交各級 都市計畫委員 會審核結果	市 級	

目 錄

第一章 前言	1
一、計畫緣由	1
二、法令依據	2
三、計畫位置	2
第二章 現行計畫概述	4
一、計畫年期	4
二、計畫面積	4
三、計畫人口	4
四、土地使用計畫及公共設施計畫	4
五、土地使用分區管制要點	13
第三章 變更內容	25
一、變更理由	25
二、變更原則	25
三、變更內容	25
第四章 變更後計畫	29
一、土地使用計畫	29
二、公共設施計畫	29
三、道路系統	29
四、土地使用分區管制要點	29
五、事業及財務計畫	42
附件一 高雄市政府經濟發展局 111 年 9 月 15 日高市府經工字第 11135079600 號函	43

圖 目 錄

圖 1-1	計畫位置示意圖.....	3
圖 2-1	和春基地土地使用計畫示意圖.....	8
圖 2-2	大發基地土地使用計畫示意圖.....	12
圖 2-3	建築基地退縮示意圖.....	20
圖 2-4	臨計畫道路之建築基地退縮示意圖.....	20
圖 2-5	和春基地退縮範圍示意圖.....	23
圖 2-6	大發基地退縮範圍示意圖.....	24
圖 4-1	建築基地退縮示意圖.....	36
圖 4-2	臨計畫道路之建築基地退縮示意圖.....	37
圖 4-3	和春基地退縮範圍示意圖.....	40
圖 4-4	大發基地退縮範圍示意圖.....	41

表 目 錄

表 2-1	和春基地土地使用面積明細表.....	7
表 2-2	大發基地土地使用面積明細表.....	11
表 3-1	土地使用分區管制要點變更內容綜理表.....	26

第一章 前言

一、計畫緣由

近年氣候變遷與能源問題受到全球重視，各國陸續提出「2050 淨零排放」的宣示與行動。為呼應全球淨零趨勢，我國於 2022 年 3 月正式公布「臺灣 2050 淨零排放路徑及策略總說明」，預計於 2030 年讓國內市區公車及公務車全面電動化、2040 年電動車及電動機車市售比 100%，並透過示範型補助計畫，引導大客車關鍵零組件在地化發展與生根；提出發展電動車產業誘因，研擬提供智慧電動車輛在地生產及關鍵零組件研發補助，加速國產電動車輛產品開發與生產。

近期國際上淨零排放在運具能源轉型方面，係以電動車取代傳統燃油車為主要之發展趨勢。行政院爰於 109 年 9 月核定經濟部「智慧電動巴士 DMIT 計畫」（前瞻基礎建設-綠能建設），就電動巴士產業發展策略、整車協作及關鍵系統（如動力、電能補充、智慧化及車控等）研擬國產化推動措施，協助國內電動巴士整車及關鍵零組件廠商投入升級開發，促使產業升級與轉型。高雄市有其堅實之既有產業環境，以既有材料與石化產業聚落優勢、循環技術及高值材料生產重鎮規劃，結合臺灣半導體研發製造及電子零組件製造全球領先技術之基礎，帶動電動車輛產業一條龍供應鏈組成與研發升級，積極布局下個世代關鍵產業，拓展產業國際競爭力。

其中，高雄市和發產業園區於 101 年 11 月 30 日列為高雄市重大施政計畫，經濟部於 103 年 7 月 17 日經工字第 10302611810 號函核定編定，園區以「綠色、智慧、永續」為願景，優先引進低污染、低排放產業進駐。園區工程開發已完成，經園區服務中心統計截至 111 年 6 月 30 日，進駐廠商共 89 家；產業用地已核准出售 92.01%，只租不售則已核准 87.89%。高雄市政府為順應發展趨勢及產業創新轉型，加速臺灣整體電動車輛及其供應鏈上下游關聯產業之發展，以實現綠能產業創新，建構永續發展環境。爰依都市計

畫法第 27 條第 1 項第 3 款辦理本次個案變更，擬透過檢討土地使用分區管制要點容許使用產業類別，對接產業轉型升級需求，促進園區土地合宜利用。

二、法令依據

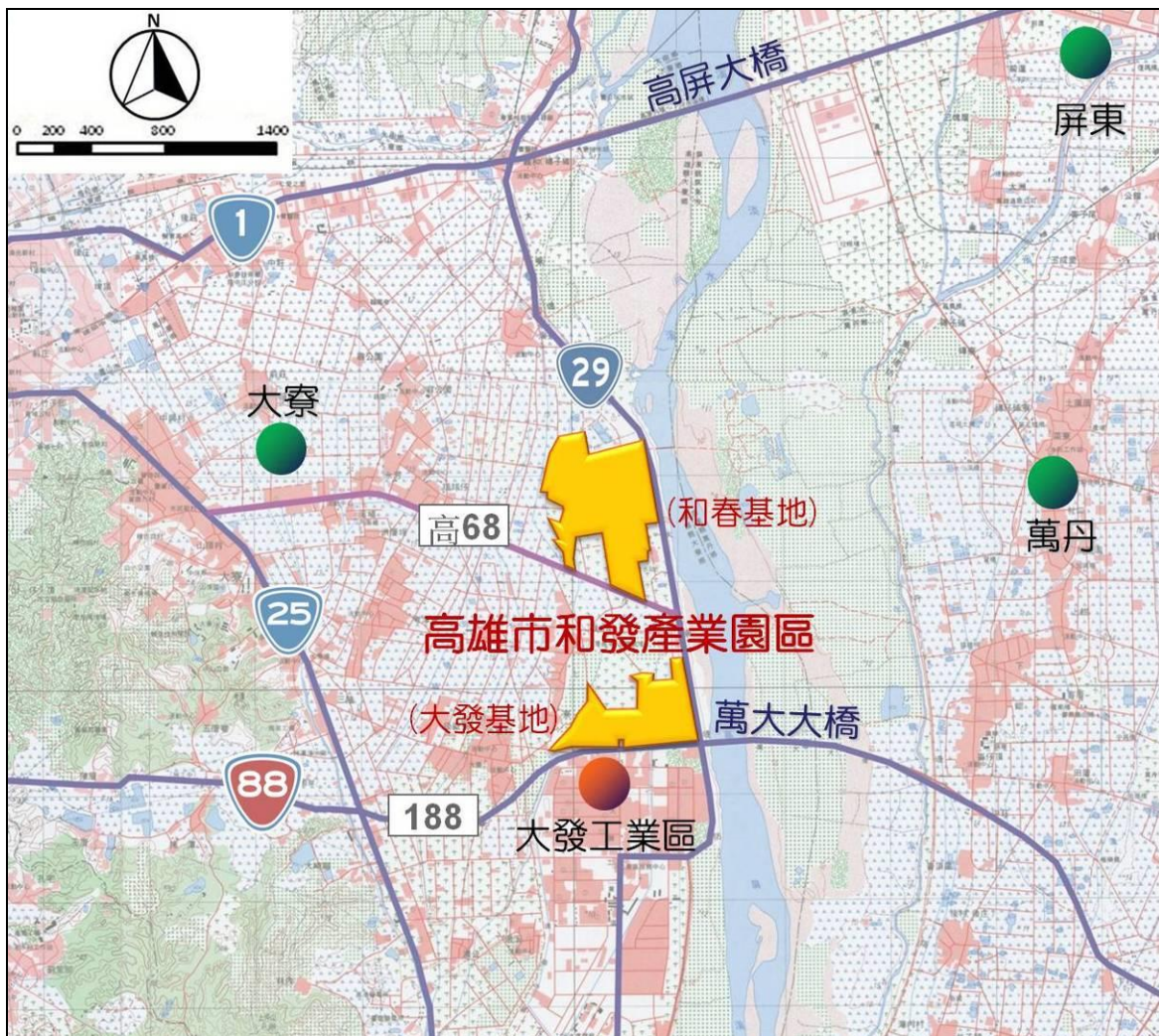
本案都市計畫變更依據係「都市計畫法」第 27 條第 1 項第 3 款『為適應國防或經濟發展之需要時』。

三、計畫位置

本計畫位於高雄市大寮區，總面積 136.13 公頃，分為和春基地（81.81 公頃）及大發基地（54.32 公頃）。計畫範圍均位屬「大坪頂以東地區都市計畫」內，計畫位置詳圖 1-1，說明如下：

和春基地位於高雄市大寮區琉球里的省道台 29 線與區道高 68 線交界處，基地西界是上寮幹線，北為台糖公司開發之萬大工業區，東鄰省道台 29 線、大寮堤防及高屏溪，東南角為水公司之給水廠及部分住宅，南隅與和春技術學院相接；南隔區道高 68 線與大發基地之距離約 1 公里。位屬「大坪頂以東地區都市計畫」內之農業區、文教區、學校用地（文高一）及部分道路用地，全區面積約 81.81 公頃。

大發基地位於高雄市大寮區上寮里的省道台 88 線（平面路段屬市道 188 線）與省道台 29 線交界處，基地西界是上寮排水，東鄰省道台 29 線、大寮堤防及高屏溪，東南隅為萬大大橋，南隔省道台 88 線與大發工業區相接，亦即位於大發工業區北側。位於「大坪頂以東地區都市計畫」內之農業區及部分 30 米四號計畫道路，全區面積約 54.32 公頃。



資料來源：中華民國台灣地區二萬五千分之一地形圖（民國90年第三版）。

圖 1-1 計畫位置示意圖

第二章 現行計畫概述

一、計畫年期

本計畫目標年配合主要計畫為民國 115 年。

二、計畫面積

本計畫面積 136.13 公頃，其中產業專用區 93.09 公頃，占全部面積 68.38%；公共設施用地 43.04 公頃，占全部面積 31.62%。

三、計畫人口

本計畫目標年將分別可引進之就業人口數，和春基地約 6,200 人及大發基地 3,800 人，計畫人口合計約 10,000 人。

四、土地使用計畫及公共設施計畫

本計畫依據高雄市施行細則第 18 條與第 20 條等相關規定，區內之土地與建物之使用管制則依據產業創新條例相關規定辦理。茲分述和春基地及大發基地之土地使用及公共設施計畫如下：

(一) 和春基地

1. 產業專用區

(1) 第一種產業專用區

即產業創新條例之產業用地（一），以供與工業生產直接或相關之行業使用為主，面積共計 51.14 公頃，占本基地總面積 62.51%。

(2) 第二種產業專用區

即產業創新條例之產業用地（二），以供配合產業發展及整體營運需要之支援產業使用，設置於本計畫區核心，鄰近服務中心處，面積 5.36 公頃，占本基地總面積 6.55%。

2. 公共設施及公用事業用地

(1) 公園（兼滯洪池）用地

為收集並調節本計畫區內各集水分區之逕流量排水而設置，可供排水、防洪設施、滯洪池、沉砂池、生態保育、綠化及休憩等設施及功能使用。西側外緣有上寮排水通過；南側有潮州寮排水通過，與自來水公司給水廠相鄰側有潮州寮排水之支線，故於此二排水在本計畫區內之下游端設置二處公園（兼滯洪池）用地。面積共計 4.20 公頃，占本基地總面積 5.13%。

(2) 綠地

配合產業園區與周邊環境之緩衝隔離需要，共劃設七處，面積共計 8.19 公頃，占本基地總面積 10.01%。

(3) 管理服務用地

於南側劃設服務中心用地，提供園區設置行政管理、工商服務等設施，可供多功能使用，面積共計 0.54 公頃，占本基地總面積 0.66%。

(4) 自來水用地

配合自來水公司配水規劃需要，於電力事業用地之東側劃設一處自來水用地，提供園區自來水事業單位及其附屬設施使用，面積共計 0.72 公頃，占本基地總面積 0.88%。

(5) 電力事業用地

依據產業引進規劃與就業人口等產業活動需求，於南側劃設一處電力事業用地，供電力事業、變電所及其附屬設施使用，面積共計 0.52 公頃，占本基地總面積 0.64%。

(6) 停車場用地

於區內劃設兩處停車場用地，除提供公共停車使用外，亦可兼具廣場之開放空間機能。面積共計 1.90 公頃，占本基地總面積 2.32%。

(7) 環保設施用地

此基地污水將收集至污水抽水站，經撈污除砂後，以管線輸送至距 700 公尺之大發基地污水處理廠，合併處理至陸放標準後，搭排至林園排水排放。

為提供污水前處理設施所需之用地，於南側留設一環保設施用地，面積 0.16 公頃，占本基地總面積 0.20%。

(8) 道路用地

共劃設 9.02 公頃，占本基地總面積 11.03%。

(9) 溝渠(兼道路)用地

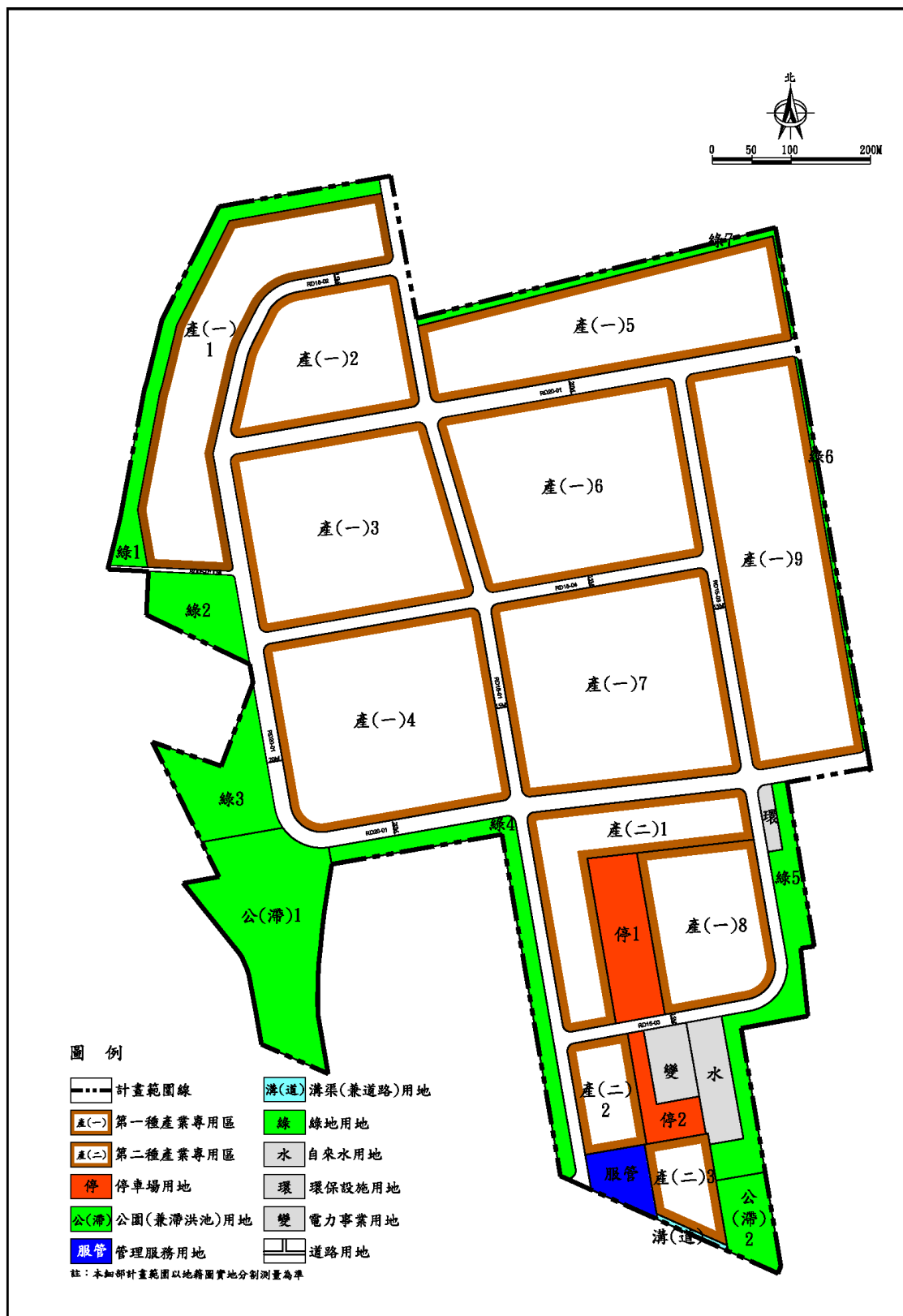
因應現況潮州寮排水寬度，於產(二)南側劃設一處溝渠(兼道路)用地，面積 0.06 公頃，占本基地總面積 0.07%。

表 2-1 和春基地土地使用面積明細表

項 目		面積 (公頃)	比例 (%)	規劃內容檢核
產業專用區	第一種產業專用區 (產業用地(一))	51.14	62.51	1. 產業用地所占面積，不得低於全區土地總面積 60% 2. 產業用地(二)土地所占面積，不得超過產業用地全部面積 30%
	第二種產業專用區 (產業用地(二))	5.36	6.55	
	小 計	56.50	69.06	
公共設施用地	公園(兼滯洪池)用地	4.20	5.13	1. 公共設施用地所占面積，不得低於全區土地總面積 20% 2. 綠地及公園使用土地之合計面積，應占全區土地總面積 10% 以上
	綠地	8.19	10.01	
	管理服務用地	0.54	0.66	
	自來水用地	0.72	0.88	
	電力事業用地	0.52	0.64	
	停車場用地	1.90	2.32	
	環保設施用地	0.16	0.20	
	道路用地	9.02	11.03	
	溝渠(兼道路)用地	0.06	0.07	
	小 計	25.31	30.94	
總 計		81.81	100.00	

註：表內面積應以依據核定圖實地分割測量面積為準。

資料來源：變更高雄市大坪頂以東地區都市計畫(和發產業園區)細部計畫(配合電力事業用地及土地使用分區管制要點調整)案，高雄市政府，111年8月。



資料來源：變更高雄市大坪頂以東地區都市計畫（和發產業園區）細部計畫（配合電力事業用地及土地使用分區管制要點調整）案，高雄市政府，111年8月。

圖 2-1 和春基地土地使用計畫示意圖

(二) 大發基地

1. 產業專用區

(1) 第一種產業專用區

即產業創新條例之產業用地（一），以供與工業生產直接或相關各行業使用為主，面積共計 34.90 公頃，占本基地總面積 64.25%。

(2) 第二種產業專用區

即產業創新條例之產業用地（二），以供配合產業發展及整體營運需要之支援產業使用，於本計畫區 30 米計畫道路之東側劃設，面積 1.69 公頃，占本基地總面積 3.11%。

2. 公共設施及公用事業用地

(1) 公園（兼滯洪池）用地

基地西側外緣有上寮排水通過，而 30 米四號計畫道路以東區塊有潮州寮排水通過，故於此二排水在本基地內之下游端設置二處公園（兼滯洪池）用地。面積共計 2.70 公頃，占總面積 4.97%。

(2) 綠地

配合台電公司上寮-九曲輸電線路於本基地內已設置之七座電桿及其線路，及工業區與周邊環境之緩衝隔離需要，共劃設十一處綠地，面積共計 5.60 公頃，占本基地總面積 10.31%。

(3) 溝渠

配合潮州寮排水流經區位，維持現況水路並劃設為溝渠用地，面積 0.44 公頃，占本基地總面積 0.81%。

(4) 自來水用地

配合自來水公司配水規劃需要，於東北角邊界處劃設一處自來水用地，提供工業區自來水事業單位及

其附屬設施使用，面積共計 0.49 公頃，占本基地總面積 0.90%。

(5) 停車場用地

劃設兩處停車場用地，以供工業區公共停車使用。面積共計 1.00 公頃，占本基地總面積 1.84%。

(6) 環保設施用地

為提供工業區污水處理設施所需之用地，於計畫區公園(兼滯洪池)用地(2)旁留設一環保設施用地，面積 1.24 公頃，占計畫區總面積 2.28%。

(7) 天然氣設施用地

因應本園區及大發工業區廠商之天然氣使用需求，規劃所需空間供整壓站使用，面積 0.06 公頃，占本基地區總面積 0.11%。

(8) 道路用地

基地內共劃設道路用地 6.20 公頃，占總面積 11.41%。

表 2-2 大發基地土地使用面積明細表

項 目		面積 (公頃)	比例 (%)	規劃內容檢核
產業專用區	第一種產業專用區 (產業用地(一))	34.90	64.25	1. 產業用地所占面積，不得低於全區土地總面積 60% 2. 產業用地(二)土地所占面積，不得超過產業用地全部面積 30%
	第二種產業專用區 (產業用地(二))	1.69	3.11	
	小 計	36.59	67.36	
公共設施用地	公園(兼滯洪池) 用地	2.70	4.97	1. 公共設施用地所占面積，不得低於全區土地總面積 20% 2. 綠地及公園使用土地之合計面積，應占全區土地總面積 10% 以上
	綠地	5.60	10.31	
	溝渠用地	0.44	0.81	
	自來水用地	0.49	0.90	
	停車場用地	1.00	1.84	
	天然氣設施用地	0.06	0.11	
	環保設施用地	1.24	2.28	
	道路用地	6.20	11.41	
	小 計	17.73	32.64	
總 計		54.32	100.00	

註：表內面積應以依據核定圖實地分割測量面積為準。

資料來源：變更高雄市大坪頂以東地區都市計畫(和發產業園區)細部計畫(配合電力事業用地及土地使用分區管制要點調整)案，高雄市政府，111年8月。



資料來源：變更高雄市大坪頂以東地區都市計畫（和發產業園區）細部計畫（配合電力事業用地及土地使用分區管制要點調整）案，高雄市政府，111年8月。

圖 2-2 大發基地土地使用計畫示意圖

五、土地使用分區管制要點

為促進高雄市和發產業園區土地利用的合理性與效率性，並塑造園區環境風格，使整體規劃符合公共安全、環境衛生與發展寧適性等目標。據此，對本園區土地及建築物之使用，按「產業創新條例」、「都市計畫法」第 22 條及同法高雄市施行細則，訂定土地使用分區管制要點。

- 第一點 本要點依據都市計畫法第二十二條規定訂定之。
- 第二點 本園區內土地及建築之使用管制，依本要點規定辦理，本要點未規定者，依產業創新條例及其他相關法令辦理。
- 第三點 本園區內土地使用依產業創新條例劃設為下列用地：
- 一、產業專用區：
 - (一) 第一種產業專用區（產業用地（一））。
 - (二) 第二種產業專用區（產業用地（二））。
 - 二、公共設施用地。
 - 三、其他經中央主管機關核定之用地。
- 第四點 第一種產業專用區（產業用地（一））係供與工業生產直接或相關之下列各行業使用：
- 一、製造業，其容許使用之產業類別細分為：
 - (一) 金屬製品製造業（25）；
 - (二) 電子零組件製造業（26）；
 - (三) 電腦、電子產品及光學製品製造業（27）：但放射性工業（包括放射性元素分裝、製造、處理工業，及原子能工業），不得進駐本產業園區；
 - (四) 電力設備製造業（28），但不包含電池製造業（282）；
 - (五) 機械設備製造業（29）；

- (六) 汽車及其零件製造業 (30) ；
- (七) 其他運輸工具及其零件製造業 (31) ；
- (八) 其他經環境影響評估審查通過同意引進之產業類別。

二、電力及燃氣供應業。

三、批發業 (不含農產原料及活動物批發業、燃料批發業、其他專賣批發業) 。

四、倉儲業 (含儲配運輸物流) 。

五、資訊及通訊傳播業 (不含影片放映業、傳播及節目播送業、電信業) 。

六、企業總管理機構及管理顧問業、研究發展服務業、專門設計服務業、工程服務及相關技術顧問業、技術檢測及分析服務業。

七、污染整治業。

八、洗衣業 (具中央工廠性質) 。

專門從事表面處理之行業，不得進駐本產業園區。

工業主管機關對於第一種產業專用區 (產業用地 (一)) 之使用用途規定有變更時，得逕依工業主管機關之規定調整。

第五點 第一種產業專用區 (產業用地 (一)) 得併供下列附屬設施使用：

一、辦公室。

二、倉庫。

三、生產實驗及訓練房舍。

四、環境保護設施。

五、單身員工宿舍。

六、員工餐廳。

七、從事觀光工廠或文化創意產業之相關設施。

第六點 第二種產業專用區（產業用地（二））係配合產業發展政策及整體營運需要，提供下列支援產業使用：

- 一、住宿及餐飲業。
- 二、金融及保險業。
- 三、機電、管道及其他建築設備安裝業。
- 四、汽車客、貨運業、運輸輔助業、郵政及快遞業。
- 五、電信業。
- 六、第四點第一項第六款以外之專業、科學及技術服務業（不含獸醫服務業、藝人及模特兒等經紀業）。
- 七、其他教育服務業。
- 八、醫療保健服務業。
- 九、創作及藝術表演業。
- 十、其他經中央主管機關核准之行業。

第一項供支援產業使用之土地，於符合建築、消防及其他安全法規規範要件下，得與第四點第一項所列行業於同一建築物內混合使用，但其所占樓地板面積，不得超過該建築物總樓地板面積百分之三十。

第七點 管理服務用地係供園區管理機構行政、金融、商務、會議、展示、研討、餐飲、購物、防救災等多功能使用為主，其容許使用項目：

- 一、行政機關。
- 二、金融、保險分支機構。
- 三、產品展示陳列設施。
- 四、會議設施、集會堂。
- 五、職業訓練教育設施。
- 六、創業輔導設施。
- 七、安全、衛生、福利、醫療設施。
- 八、通訊設施與機構。

- 九、公用事業設施。
- 十、招待所、員工活動中心。
- 十一、轉運設施、停車場。
- 十二、餐飲業。
- 十三、警察消防機構。
- 十四、其他經中央主管機關核准之服務設施。

第八點 公共設施用地之容許使用項目如下：

- 一、公園（兼滯洪池）用地：供綠化景觀設施、水土保持設施、防洪設施、滯洪池、生態保育設施等使用；並得供輸配電鐵塔使用。
- 二、綠地用地：以綠化使用為主，並得為防風林、景觀綠帶、隔離綠帶、供輸配電鐵塔等設施使用。
- 三、溝渠用地：供灌溉、排水等設施使用。
- 四、自來水用地：供自來水事業設施及其附屬設施使用。
- 五、電力事業用地：提供電力事業及其附屬設施使用。
- 六、環保設施用地：提供污水處理、廢棄物收集設施與環境監測及其附屬設施使用。
- 七、停車場用地：供興建平面、立體停車場、相關交通服務設施及其附屬設施使用。
- 八、道路用地：供道路、管制哨及相關道路附屬設施使用。
- 九、溝渠(兼道路)用地：供排水設施使用，並兼供道路使用。
- 十、天然氣設施用地：供天然氣整壓配氣相關設施使用。

第九點 法定建蔽率及容積率上限規定如下：

使用分區/用地	建蔽率(%)	容積率(%)
第一種產業專用區 (產業用地(一))	60	210

使用分區/用地		建蔽率(%)	容積率(%)	
第二種產業專用區 (產業用地(二))		60	300	
公共設施用地	管理服務用地	60	240	
	公園(兼滯洪池)用地	15	30	
	自來水用地	50	150	
	電力事業用地	50	150	
	停車場用地	平面	10	20
		立體	80	240
	環保設施用地	50	150	
天然氣設施用地	50	150		

為因應廠商進駐設廠之需求，提高土地使用彈性，第一種產業專用區容積管制規定如下：

- 一、第一種產業專用區容積率不得超過 210%，惟申請建築時，產業園區目的事業主管機關得視設廠性質及需求酌予增加容積率，增加後容積率不得超過 300%。
- 二、目的事業主管機關應進行本計畫範圍內第一種產業專用區總容積管制，即和春基地第一種產業專用區總容積不得超過 1,229,040 平方公尺；大發基地第一種產業專用區總容積不得超過 822,480 平方公尺。

第十點 本園區內建築基地不得適用建築技術規則及其他有關容積獎勵相關法規之規定。

第十一點 本園區內停車場用地之規劃與設計原則：

- 一、停車場週邊(含退縮地)應設置寬度 2 公尺以上之綠帶，並以遮蔭大型喬木及 1.5 公尺以上綠籬適當分隔停車空間。
- 二、每處停車場之聯外出入口不得超過兩個。
- 三、每三個停車位至少種植一株遮蔭喬木，每十個併排汽車停車位間須設置栽植槽。

第十二點 本園區內建築基地之附設停車空間應依下表規定辦理：

使用分區	汽車停車位	機車停車位
第一種產業專用區 (產業用地(一))	樓地板面積每 250 平方公尺設置一輛，經計算設置停車空間數量未達整數時，其零數應設置一輛。停車空間得以機械停車方式為之。	樓地板面積每 300 平方公尺設置一輛。
第二種產業專用區 (產業用地(二))		
管理服務用地		

說明：1. 樓地板面積之計算，不包括室內停車空間、法定防空避難設備、騎樓或門廊、外廊等無牆壁之面積，及機械房、變電室、蓄水池、屋頂突出物等類似用途部份。所謂「類似用途」空間係指「為建築物之必要附屬設備空間或因廠房之特殊作業行為所衍生之空間，不因增設該空間而產生停車空間需求者為限」。

2. 建築物附設之停車空間數量中，應提供不少於百分之二停車數量為行動不便停車位（數量未達整數時，其零數應設置一輛）。

3. 其他均依建築技術規則之規定辦理。

建築基地之自行車停車位應依「高雄市都市設計審議地區建築基地附設自行車停車位規定」辦理。

第十三點 本園區貨物裝卸位設置數量應按下表規定辦理：

使用分區	應附設裝卸位數
第一種產業專用區 (產業用地(一))	每一基地至少須附設一裝卸位。
第二種產業專用區 (產業用地(二))	樓地板面積在 500 平方公尺(含)以上至 3,000 平方公尺(含)者，應附設一裝卸位，總樓地板面積 3,000 平方公尺以上者，每超過 3,000 平方公尺或其零數應增設一裝卸位。

說明：1. 每一裝卸位寬度不得小於 4 公尺、長度不得小於 13 公尺，有頂蓋者其高度不得小於 4.2 公尺，但若須使用貨櫃車裝卸者，應依實際所需規模設置。

2. 裝卸位應設置在同一建築基地內，同一幢建築物內供二類以上用途使用者，設置標準分別計算附設。

3. 貨物裝卸位及堆積場應避免直接曝露於道路及永久性開放空間之公共視野內，且須以建築物或適當設施或植栽作有效遮擋。

4. 基地裝卸位及堆積場不得佔用退縮地。

第十四點 本園區建築物之退縮深度應符合下列標準：

一、指定退縮地規定如下：

	建築基地面臨道路寬度				非臨道路側	
	30 公尺	20 公尺	15 公尺	5 公尺	臨省道 及市道	其他
退縮深度 (公尺)	8	6	5	4	5	3

二、建築基地如位於角地，其退縮線應自兩退縮線交叉點再各自退縮最短邊規定深度位置連線為其退縮線，詳如圖 2-3 所示。

三、自來水用地及電力事業用地臨綠地側，得免退縮。

四、大發基地環保設施用地應自地界周邊分別至少退縮 10 公尺建築，並應妥予植栽綠化作為區隔，不受上表列之退縮地建築規定；另和春基地環保設施用地淨寬僅 26 公尺，依上表之退縮建築規定辦理。

五、和春基地管理服務用地南側應自地界周邊至少退縮 6 公尺建築。

六、退縮地臨道路側應留設 1 公尺之植草緩衝帶，其餘種植高度低於 1.5 公尺之灌木，並等距列植喬木(如圖 2-4)，植栽應與相鄰基地之退縮地植栽自然銜接，視覺上須對外開放，不得設置圍牆隔離，得計入法定空地。

七、退縮地得埋設公共管線，且以地下化為原則，並應避免破壞退縮地之完整性；若必需設置於地面上之設備(如電力、電信箱)，應予遮蔽並加以綠化植栽處理，且須符合各公共設備事業單位之規定。

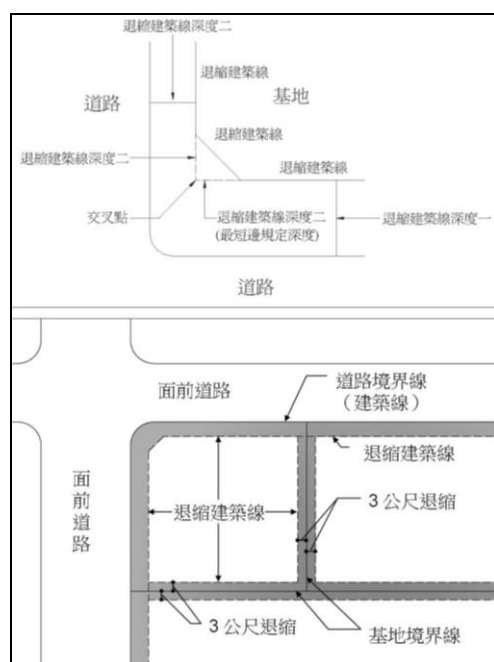


圖 2-3 建築基地退縮示意圖

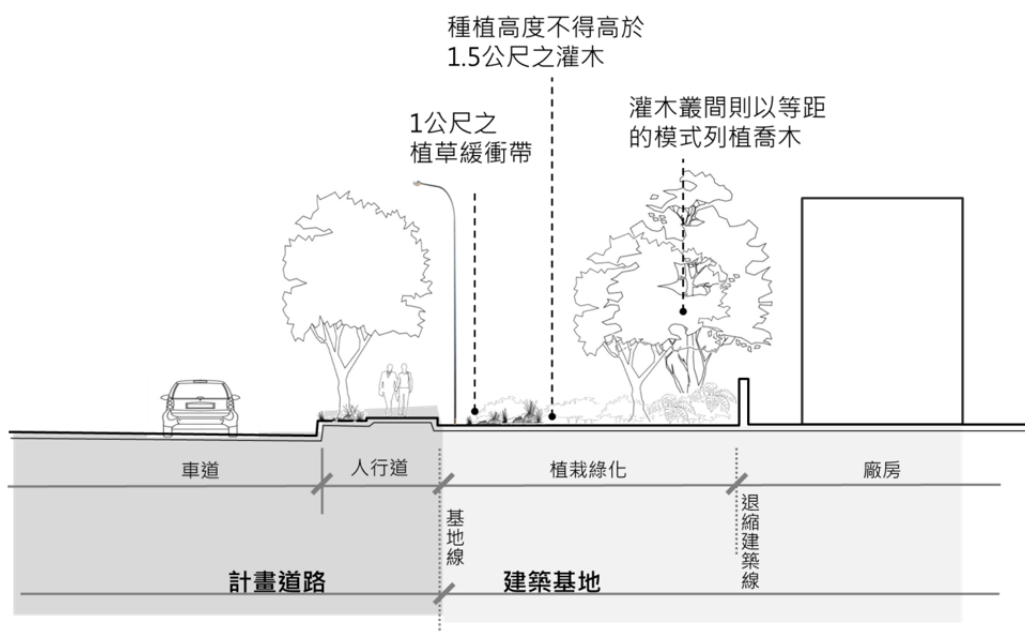


圖 2-4 臨計畫道路之建築基地退縮示意圖

第十五點 建築物應留設之法定空地以集中留設為原則，綠覆率應達百分之五十以上。有關綠覆率、綠覆面積之計算基準應依「高雄市都市設計審議原則」辦理。

第十六點 面臨 30 公尺四號計畫道路及省道台 88 縣（市道 188 線）之建築基地，該道路沿線不得設置車輛出入口。惟

視基地開發需求，經本園區管理機構同意者，不在此限。

第十七點 本園區之建築基地不分規模應予綠化，檢討計算依建築基地綠化設計技術規範辦理。其建築物均應依高雄市綠建築自治條例之規定辦理。

第十八點 建築物臨街立面之附屬設備（冷氣機、水塔、廢氣排出口等）應配合建築物立面整體設計或遮蔽。

第十九點 屋頂突出物應配合建築物造型作整體設計或遮蔽。

第二十點 本園區內建築物應依建築技術規則建築設計施工篇第三百二十一條至第三百二十三條（綠建材）之規定辦理，且立面材料不得使用石綿瓦、塑膠浪板、未經處理之金屬浪板、其他具公害或易燃性材料。

第二十一點 本園區指標設施之設置應依下列原則辦理：

一、基地出入口標示物

- （一）應設置於廠址使用之道路側，並擇主要出入口旁退縮地範圍，距建築線至少 1.5 公尺。
- （二）標示物只限於標示地址、聯絡方式、建築物名稱、公司機構名稱及企業標誌。
- （三）標示物之立面面積不得超過 8 平方公尺，垂直高度不得超過 2.5 公尺。

二、建築物壁面標示物

- （一）僅限標示建築物名稱、公司機構名稱及企業標誌。
- （二）每棟建築物之單一臨街立面得設置一處牆面標示物；每一基地內之牆面標示物最多設二處，且不得在屋頂突出物上出現；但建築物之單一鄰街立面長度超過 200 公尺以上，每 200 公尺可增設牆面標示物一處，標示物數量不受前述規定限制。

(三) 牆面標示物面積以不得超過 4.5 平方公尺，字高不得超過 1.2 公尺。

惟視基地開發需求，經本園區管理機構同意者，不在此限。

第二十二點 各類公有建築、公共設施及其開放空間之新建、增建、改建，不得設置圍牆。倘基於公共安全考量，經園區管理機構同意者，不在此限。

第二十三點 前點以外之建築如設置圍牆者，應符合下列規定：

一、沿街面之圍牆應採透視性設計或設置綠籬，其圍牆高度自基地地面不得高於 180 公分，且牆面視覺可穿透比率需達百分之五十以上；其他圍牆高度不得高於 250 公分。

二、供汽車或人行進出之出入口圍牆高度以地面層樓高，且以不超過 4 公尺為限，該部分得免檢討視覺可穿透比率。

惟視基地開發需求，經本園區管理機構同意者，不在此限。

第二十四點 植栽綠化應包含喬木、灌木草花及地被等植栽，且植栽不得遮蔽或妨礙各項標誌、燈號等系統、公共人行通道及車輛出入口。

第二十五點 沿街面種植之喬木應選用深根性、枝幹強韌、根系垂直之樹種，且配合相鄰基地沿街面喬木樹種，維持街道景觀協調。

第二十六點 本園區各基地免依建築技術規則設置雨水貯集滯洪設施。

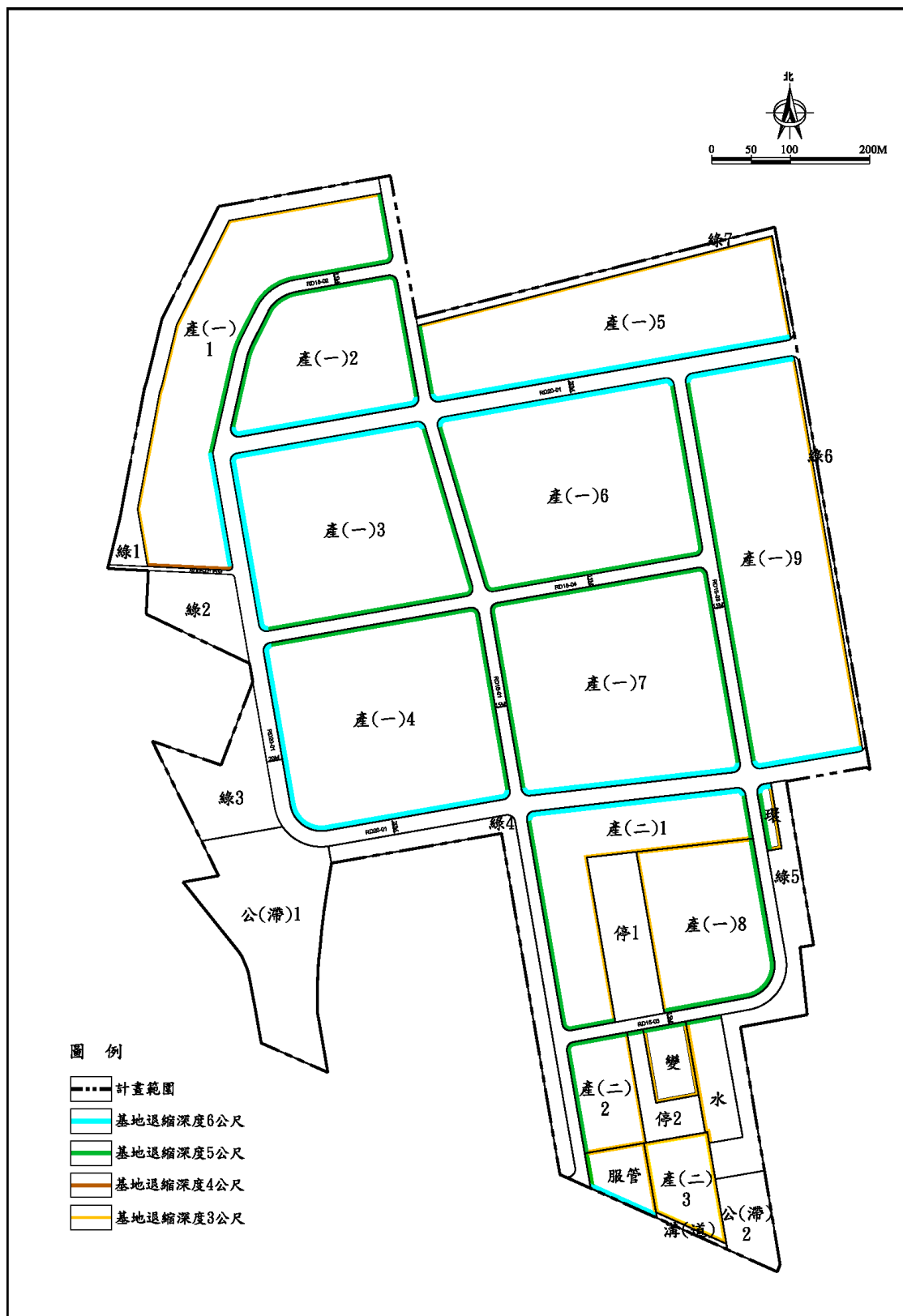
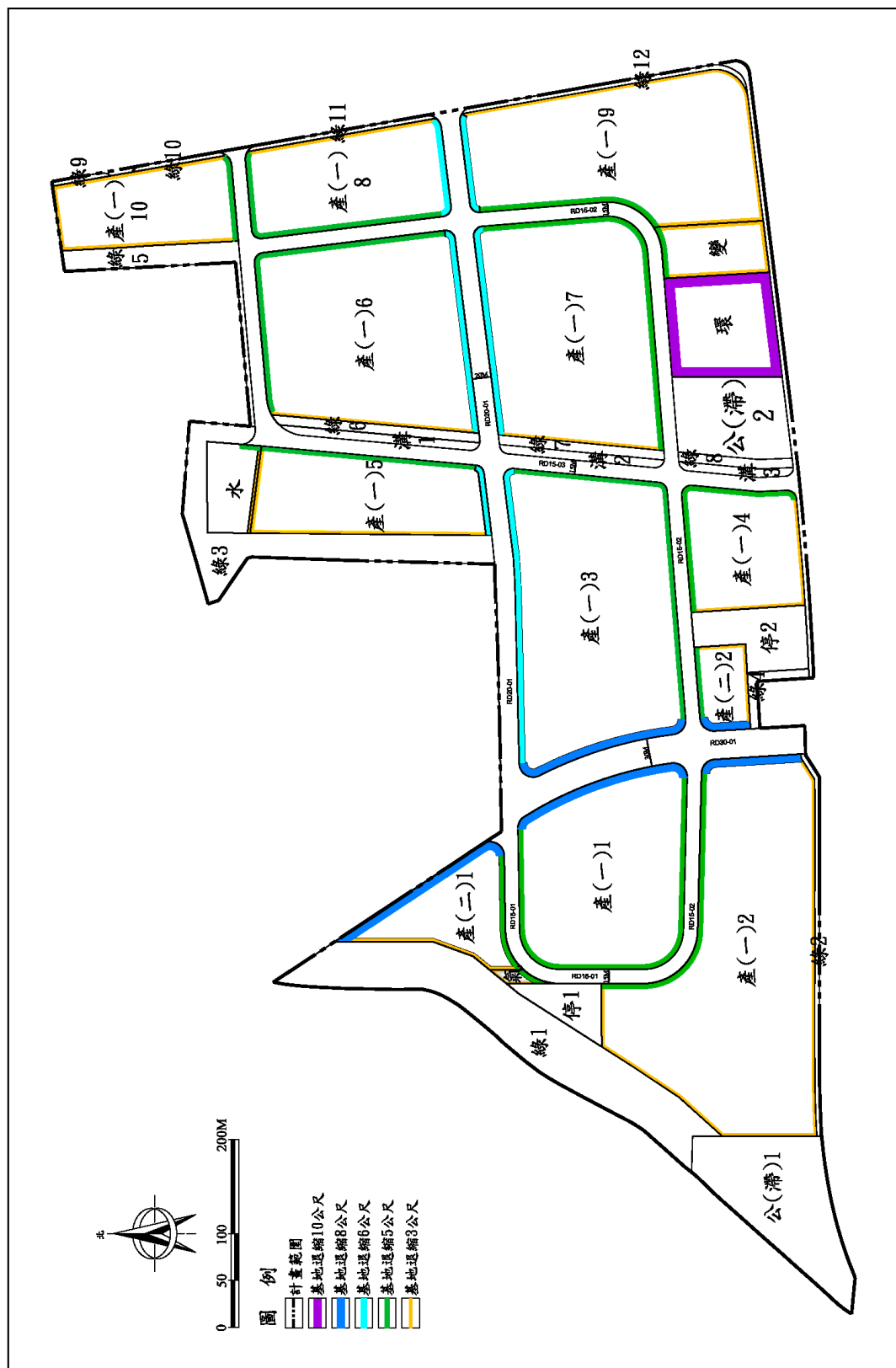


圖 2-5 和春基地退縮範圍示意圖



第三章 變更內容

一、變更理由

(一) 帶動產業供應鏈之建構

為實現 2050 淨零排放，電動車輛產業為一大發展目標，本計畫配合調整土地使用分區管制之容許使用項目，強化高雄市產業創新轉型，支援電動車輛產業建構完整供應鏈生態系，以因應發展趨勢。其中電池、馬達與電池管理系統為電動車輛關鍵零組件，決定電動車輛性能。電動車輛產業鏈包括上游的鋰電池粉體材料，中游的大功率鋰電池、電池管理系統、動力馬達，及下游的整車組裝與銷售。

(二) 因應區內廠商發展需求

配合政府產業發展政策區內進駐廠商今(111)年 6 月宣布成立台灣電池芯研發暨試量產中心，將新建 1.2 萬坪廠房，整體投資額達 60 億元，預計 113 年第一季量產，提供電動巴士、乘用車及儲能等電池芯應用初期所需，建立完整電動車關鍵零組件供應鏈。惟目前和發產業園區允許進駐產業類別尚無包含電池製造業，爰亟需辦理相關計畫之變更，以利整合從上游材料、中游電池芯到下游電池包，建立一條龍在地化電池芯產業鏈，進而應用於電動巴士、乘用車及儲能設施等，完備台灣電力設備製造產業之整體發展，作為電動車輛及相關綠能產業基石。

二、變更原則

放寬部分容許使用項目，以因應整體產業轉型升級，強化產業供應鏈，提高產業發展競爭力。

三、變更內容

變更第一種產業專用區（產業用地（一））之容許使用項目，變更內容綜理詳表 3-1 所示。

表 3-1 土地使用分區管制要點變更內容綜理表

原條文	新條文	變更理由
<p>第四點 第一種產業專用區（產業用地（一））係供與工業生產直接或相關之下列各行業使用：</p> <p>一、製造業，其容許使用之產業類別細分為：</p> <p>（一）金屬製品製造業（25）；</p> <p>（二）電子零組件製造業（26）；</p> <p>（三）電腦、電子產品及光學製品製造業（27）：但放射性工業（包括放射性元素分裝、製造、處理工業，及原子能工業），不得進駐本產業園區；</p> <p>（四）電力設備製造業（28），但不包含電池製造業（282）；</p> <p>（五）機械設備製造業（29）；</p>	<p>第四點 第一種產業專用區（產業用地（一））係供與工業生產直接或相關之下列各行業使用：</p> <p>一、製造業，其容許使用之產業類別細分為：</p> <p>（一）金屬製品製造業（25）；</p> <p>（二）電子零組件製造業（26）；</p> <p>（三）電腦、電子產品及光學製品製造業（27）：但放射性工業（包括放射性元素分裝、製造、處理工業，及原子能工業），不得進駐本產業園區；</p> <p>（四）電力設備製造業（28），但不包含電池製造業（282）<u>僅限鋰電池</u>製造；</p> <p>（五）機械設備製</p>	<p>為支援電動車輛產業發展，建構完整產業供應鏈生態系，完備台灣電力設備製造產業之整體發展，配合調整容許使用項目。惟需兼顧環境永續利用，僅放寬容許鋰電池製造之電池製造業進駐園區。</p>

原條文	新條文	變更理由
<p>(六) 汽車及其零件製造業 (30)；</p> <p>(七) 其他運輸工具及其零件製造業 (31)；</p> <p>(八) 其他經環境影響評估審查通過同意引進之產業類別。</p> <p>二、電力及燃氣供應業。</p> <p>三、批發業 (不含農產原料及活動物批發業、燃料批發業、其他專賣批發業)。</p> <p>四、倉儲業 (含儲配運輸物流)。</p> <p>五、資訊及通訊傳播業 (不含影片放映業、傳播及節目播送業、電信業)。</p> <p>六、企業總管理機構及管理顧問業、研究發展服務業、專門設計服務業、工程服務及相關技術顧問業、技術檢</p>	<p>造業 (29)；</p> <p>(六) 汽車及其零件製造業 (30)；</p> <p>(七) 其他運輸工具及其零件製造業 (31)；</p> <p>(八) 其他經環境影響評估審查通過同意引進之產業類別。</p> <p>二、電力及燃氣供應業。</p> <p>三、批發業 (不含農產原料及活動物批發業、燃料批發業、其他專賣批發業)。</p> <p>四、倉儲業 (含儲配運輸物流)。</p> <p>五、資訊及通訊傳播業 (不含影片放映業、傳播及節目播送業、電信業)。</p> <p>六、企業總管理機構及管理顧問業、研究發展服務業、專門設計服務業、工程服務及相關技</p>	

原條文	新條文	變更理由
<p>測及分析服務業。</p> <p>七、污染整治業。</p> <p>八、洗衣業（具中央工廠性質）。</p> <p>專門從事表面處理之行業，不得進駐本產業園區。</p> <p>工業主管機關對於第一種產業專用區（產業用地（一））之使用用途規定有變更時，得逕依工業主管機關之規定調整。</p>	<p>術顧問業、技術檢測及分析服務業。</p> <p>七、污染整治業。</p> <p>八、洗衣業（具中央工廠性質）。</p> <p>專門從事表面處理之行業，不得進駐本產業園區。</p> <p>工業主管機關對於第一種產業專用區（產業用地（一））之使用用途規定有變更時，得逕依工業主管機關之規定調整。</p>	

第四章 變更後計畫

一、土地使用計畫

本計畫未涉及土地使用計畫之變更。

二、公共設施計畫

本計畫未涉及公共設施計畫之變更。

三、道路系統

本計畫未涉及道路系統之變更。

四、土地使用分區管制要點

為促進高雄市和發產業園區土地利用的合理性與效率性，並塑造園區環境風格，使整體規劃符合公共安全、環境衛生與發展寧適性等目標。據此，對本園區土地及建築物之使用，按「產業創新條例」、「都市計畫法」第 22 條及同法高雄市施行細則，訂定土地使用分區管制要點。

第一點 本要點依據都市計畫法第二十二條規定訂定之。

第二點 本園區內土地及建築之使用管制，依本要點規定辦理，本要點未規定者，依產業創新條例及其他相關法令辦理。

第三點 本園區內土地使用依產業創新條例劃設為下列用地：

一、產業專用區：

(一) 第一種產業專用區（產業用地（一））。

(二) 第二種產業專用區（產業用地（二））。

二、公共設施用地。

三、其他經中央主管機關核定之用地。

第四點 第一種產業專用區（產業用地（一））係供與工業生產直接或相關之下列各行業使用：

- 一、製造業，其容許使用之產業類別細分為：
 - (一) 金屬製品製造業 (25) ；
 - (二) 電子零組件製造業 (26) ；
 - (三) 電腦、電子產品及光學製品製造業 (27) ；但放射性工業 (包括放射性元素分裝、製造、處理工業，及原子能工業) ，不得進駐本產業園區；
 - (四) 電力設備製造業 (28) ，但電池製造業 (282) 僅限鋰電池製造；
 - (五) 機械設備製造業 (29) ；
 - (六) 汽車及其零件製造業 (30) ；
 - (七) 其他運輸工具及其零件製造業 (31) ；
 - (八) 其他經環境影響評估審查通過同意引進之產業類別。
 - 二、電力及燃氣供應業。
 - 三、批發業 (不含農產原料及活動物批發業、燃料批發業、其他專賣批發業) 。
 - 四、倉儲業 (含儲配運輸物流) 。
 - 五、資訊及通訊傳播業 (不含影片放映業、傳播及節目播送業、電信業) 。
 - 六、企業總管理機構及管理顧問業、研究發展服務業、專門設計服務業、工程服務及相關技術顧問業、技術檢測及分析服務業。
 - 七、污染整治業。
 - 八、洗衣業 (具中央工廠性質) 。
- 專門從事表面處理之行業，不得進駐本產業園區。
- 工業主管機關對於第一種產業專用區 (產業用地 (一)) 之使用用途規定有變更時，得逕依工業主管機關之規定調整。

第五點 第一種產業專用區（產業用地（一））得併供下列附屬設施使用：

- 一、辦公室。
- 二、倉庫。
- 三、生產實驗及訓練房舍。
- 四、環境保護設施。
- 五、單身員工宿舍。
- 六、員工餐廳。
- 七、從事觀光工廠或文化創意產業之相關設施。

第六點 第二種產業專用區（產業用地（二））係配合產業發展政策及整體營運需要，提供下列支援產業使用：

- 一、住宿及餐飲業。
- 二、金融及保險業。
- 三、機電、管道及其他建築設備安裝業。
- 四、汽車客、貨運業、運輸輔助業、郵政及快遞業。
- 五、電信業。
- 六、第四點第一項第六款以外之專業、科學及技術服務業（不含獸醫服務業、藝人及模特兒等經紀業）。
- 七、其他教育服務業。
- 八、醫療保健服務業。
- 九、創作及藝術表演業。
- 十、其他經中央主管機關核准之行業。

第一項供支援產業使用之土地，於符合建築、消防及其他安全法規規範要件下，得與第四點第一項所列行業於同一建築物內混合使用，但其所占樓地板面積，不得超過該建築物總樓地板面積百分之三十。

第七點 管理服務用地係供園區管理機構行政、金融、商務、會議、展示、研討、餐飲、購物、防救災等多功能使用為

主，其容許使用項目：

- 一、行政機關。
- 二、金融、保險分支機構。
- 三、產品展示陳列設施。
- 四、會議設施、集會堂。
- 五、職業訓練教育設施。
- 六、創業輔導設施。
- 七、安全、衛生、福利、醫療設施。
- 八、通訊設施與機構。
- 九、公用事業設施。
- 十、招待所、員工活動中心。
- 十一、轉運設施、停車場。
- 十二、餐飲業。
- 十三、警察消防機構。
- 十四、其他經中央主管機關核准之服務設施。

第八點 公共設施用地之容許使用項目如下：

- 一、公園（兼滯洪池）用地：供綠化景觀設施、水土保持設施、防洪設施、滯洪池、生態保育設施等使用；並得供輸配電鐵塔使用。
- 二、綠地用地：以綠化使用為主，並得為防風林、景觀綠帶、隔離綠帶、供輸配電鐵塔等設施使用。
- 三、溝渠用地：供灌溉、排水等設施使用。
- 四、自來水用地：供自來水事業設施及其附屬設施使用。
- 五、電力事業用地：提供電力事業及其附屬設施使用。
- 六、環保設施用地：提供污水處理、廢棄物收集設施與環境監測及其附屬設施使用。
- 七、停車場用地：供興建平面、立體停車場、相關交通

服務設施及其附屬設施使用。

八、道路用地：供道路、管制哨及相關道路附屬設施使用。

九、溝渠(兼道路)用地：供排水設施使用，並兼供道路使用。

十、天然氣設施用地：供天然氣整壓配氣相關設施使用。

第九點 法定建蔽率及容積率上限規定如下：

使用分區/用地		建蔽率(%)	容積率(%)	
第一種產業專用區 (產業用地(一))		60	210	
第二種產業專用區 (產業用地(二))		60	300	
公共設施用地	管理服務用地	60	240	
	公園(兼滯洪池)用地	15	30	
	自來水用地	50	150	
	電力事業用地	50	150	
	停車場用地	平面	10	20
		立體	80	240
	環保設施用地	50	150	
	天然氣設施用地	50	150	

為因應廠商進駐設廠之需求，提高土地使用彈性，第一種產業專用區容積管制規定如下：

一、第一種產業專用區容積率不得超過 210%，惟申請建築時，產業園區目的事業主管機關得視設廠性質及需求酌予增加容積率，增加後容積率不得超過 300%。

二、目的事業主管機關應進行本計畫範圍內第一種產業專用區總容積管制，即和春基地第一種產業專用區總容積不得超過 1,229,040 平方公尺；大發基地第一種產業專用區總容積不得超過 822,480 平方公尺。

第十點 本園區內建築基地不得適用建築技術規則及其他有關容積獎勵相關法規之規定。

第十一點 本園區內停車場用地之規劃與設計原則：

- 一、停車場週邊（含退縮地）應設置寬度 2 公尺以上之綠帶，並以遮蔭大型喬木及 1.5 公尺以上綠籬適當分隔停車空間。
- 二、每處停車場之聯外出入口不得超過兩個。
- 三、每三個停車位至少種植一株遮蔭喬木，每十個併排汽車停車位間須設置栽植槽。

第十二點 本園區內建築基地之附設停車空間應依下表規定辦理：

使用分區	汽車停車位	機車停車位
第一種產業專用區 (產業用地(一))	樓地板面積每 250 平方公尺設置一輛，經計算設置停車空間數量未達整數時，其零數應設置一輛。停車空間得以機械停車方式為之。	樓地板面積每 300 平方公尺設置一輛。
第二種產業專用區 (產業用地(二))		
管理服務用地		

說明：1. 樓地板面積之計算，不包括室內停車空間、法定防空避難設備、騎樓或門廊、外廊等無牆壁之面積，及機械房、變電室、蓄水池、屋頂突出物等類似用途部份。所謂「類似用途」空間係指「為建築物之必要附屬設備空間或因廠房之特殊作業行為所衍生之空間，不因增設該空間而產生停車空間需求者為限」。

2. 建築物附設之停車空間數量中，應提供不少於百分之二停車數量為行動不便停車位（數量未達整數時，其零數應設置一輛）。

3. 其他均依建築技術規則之規定辦理。

建築基地之自行車停車位應依「高雄市都市設計審議地區建築基地附設自行車停車位規定」辦理。

第十三點 本園區貨物裝卸位設置數量應按下表規定辦理：

使用分區	應附設裝卸位數
第一種產業專用區 (產業用地(一))	每一基地至少須附設一裝卸位。

使用分區	應附設裝卸位數
第二種產業專用區 (產業用地(二))	樓地板面積在 500 平方公尺(含)以上至 3,000 平方公尺(含)者,應附設一裝卸位,總樓地板面積 3,000 平方公尺以上者,每超過 3,000 平方公尺或其零數應增設一裝卸位。

- 說明：1. 每一裝卸位寬度不得小於 4 公尺、長度不得小於 13 公尺，有頂蓋者其高度不得小於 4.2 公尺，但若須使用貨櫃車裝卸者，應依實際所需規模設置。
2. 裝卸位應設置在同一建築基地內，同一幢建築物內供二類以上用途使用者，設置標準分別計算附設。
3. 貨物裝卸位及堆積場應避免直接曝露於道路及永久性開放空間之公共視野內，且須以建築物或適當設施或植栽作有效遮擋。
4. 基地裝卸位及堆積場不得佔用退縮地。

第十四點 本園區建築物之退縮深度應符合下列標準：

一、指定退縮地規定如下：

	建築基地面臨道路寬度				非臨道路側	
	30 公尺	20 公尺	15 公尺	5 公尺	臨省道及市道	其他
退縮深度(公尺)	8	6	5	4	5	3

二、建築基地如位於角地，其退縮線應自兩退縮線交叉點再各自退縮最短邊規定深度位置連線為其退縮線，詳如圖 4-1 所示。

三、自來水用地及電力事業用地臨綠地側，得免退縮。

四、大發基地環保設施用地應自地界周邊分別至少退縮 10 公尺建築，並應妥予植栽綠化作為區隔，不受上表列之退縮地建築規定；另和春基地環保設施用地淨寬僅 26 公尺，依上表之退縮建築規定辦理。

五、和春基地管理服務用地南側應自地界周邊至少退縮 6 公尺建築。

六、退縮地臨道路側應留設 1 公尺之植草緩衝帶，其餘

種植高度低於 1.5 公尺之灌木，並等距列植喬木(如圖 4-2)，植栽應與相鄰基地之退縮地植栽自然銜接，視覺上須對外開放，不得設置圍牆隔離，得計入法定空地。

- 七、退縮地得埋設公共管線，且以地下化為原則，並應避免破壞退縮地之完整性；若必需設置於地面上之設備(如電力、電信箱)，應予遮蔽並加以綠化植栽處理，且須符合各公共設備事業單位之規定。

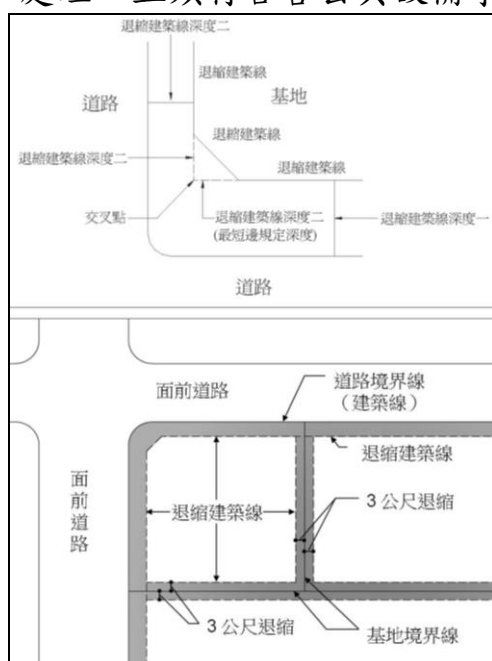


圖 4-1 建築基地退縮示意圖

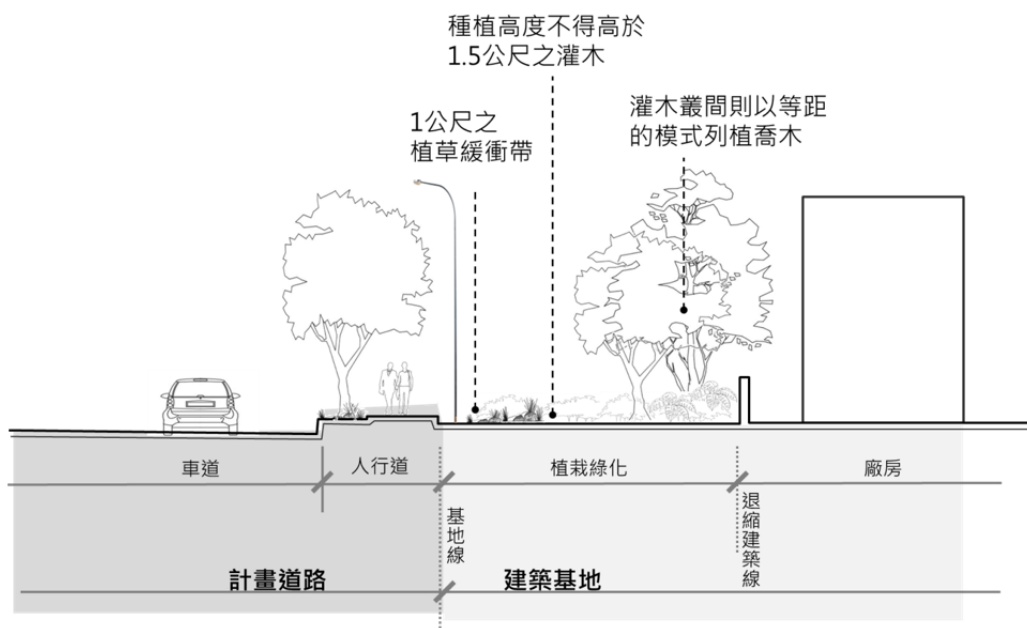


圖 4-2 臨計畫道路之建築基地退縮示意圖

- 第十五點 建築物應留設之法定空地以集中留設為原則，綠覆率應達百分之五十以上。有關綠覆率、綠覆面積之計算基準應依「高雄市都市設計審議原則」辦理。
- 第十六點 面臨 30 公尺四號計畫道路及省道台 88 縣（市道 188 線）之建築基地，該道路沿線不得設置車輛出入口。惟視基地開發需求，經本園區管理機構同意者，不在此限。
- 第十七點 本園區之建築基地不分規模應予綠化，檢討計算依建築基地綠化設計技術規範辦理。其建築物均應依高雄市綠建築自治條例之規定辦理。
- 第十八點 建築物臨街立面之附屬設備（冷氣機、水塔、廢氣排出口等）應配合建築物立面整體設計或遮蔽。
- 第十九點 屋頂突出物應配合建築物造型作整體設計或遮蔽。
- 第二十點 本園區內建築物應依建築技術規則建築設計施工篇第三百二十一條至第三百二十三條（綠建材）之規定辦理，且立面材料不得使用石綿瓦、塑膠浪板、未經處理之金屬浪板、其他具公害或易燃性材料。

第二十一點 本園區指標設施之設置應依下列原則辦理：

一、基地出入口標示物

- (一) 應設置於廠址使用之道路側，並擇主要出入口旁退縮地範圍，距建築線至少 1.5 公尺。
- (二) 標示物只限於標示地址、聯絡方式、建築物名稱、公司機構名稱及企業標誌。
- (三) 標示物之立面面積不得超過 8 平方公尺，垂直高度不得超過 2.5 公尺。

二、建築物壁面標示物

- (一) 僅限標示建築物名稱、公司機構名稱及企業標誌。
- (二) 每棟建築物之單一臨街立面得設置一處牆面標示物；每一基地內之牆面標示物最多設二處，且不得在屋頂突出物上出現；但建築物之單一鄰街立面長度超過 200 公尺以上，每 200 公尺可增設牆面標示物一處，標示物數量不受前述規定限制。
- (三) 牆面標示物面積以不得超過 4.5 平方公尺，字高不得超過 1.2 公尺。

惟視基地開發需求，經本園區管理機構同意者，不在此限。

第二十二點 各類公有建築、公共設施及其開放空間之新建、增建、改建，不得設置圍牆。倘基於公共安全考量，經園區管理機構同意者，不在此限。

第二十三點 前點以外之建築如設置圍牆者，應符合下列規定：

- 一、沿街面之圍牆應採透視性設計或設置綠籬，其圍牆高度自基地地面不得高於 180 公分，且牆面視覺可穿透比率需達百分之五十以上；其他圍牆高度不得

高於 250 公分。

二、供汽車或人行進出之出入口圍牆高度以地面層樓高，且以不超過 4 公尺為限，該部分得免檢討視覺可穿透比率。

惟視基地開發需求，經本園區管理機構同意者，不在此限。

第二十四點 植栽綠化應包含喬木、灌木草花及地被等植栽，且植栽不得遮蔽或妨礙各項標誌、燈號等系統、公共人行通道及車輛出入口。

第二十五點 沿街面種植之喬木應選用深根性、枝幹強韌、根系垂直之樹種，且配合相鄰基地沿街面喬木樹種，維持街道景觀協調。

第二十六點 本園區各基地免依建築技術規則設置雨水貯集滯洪設施。

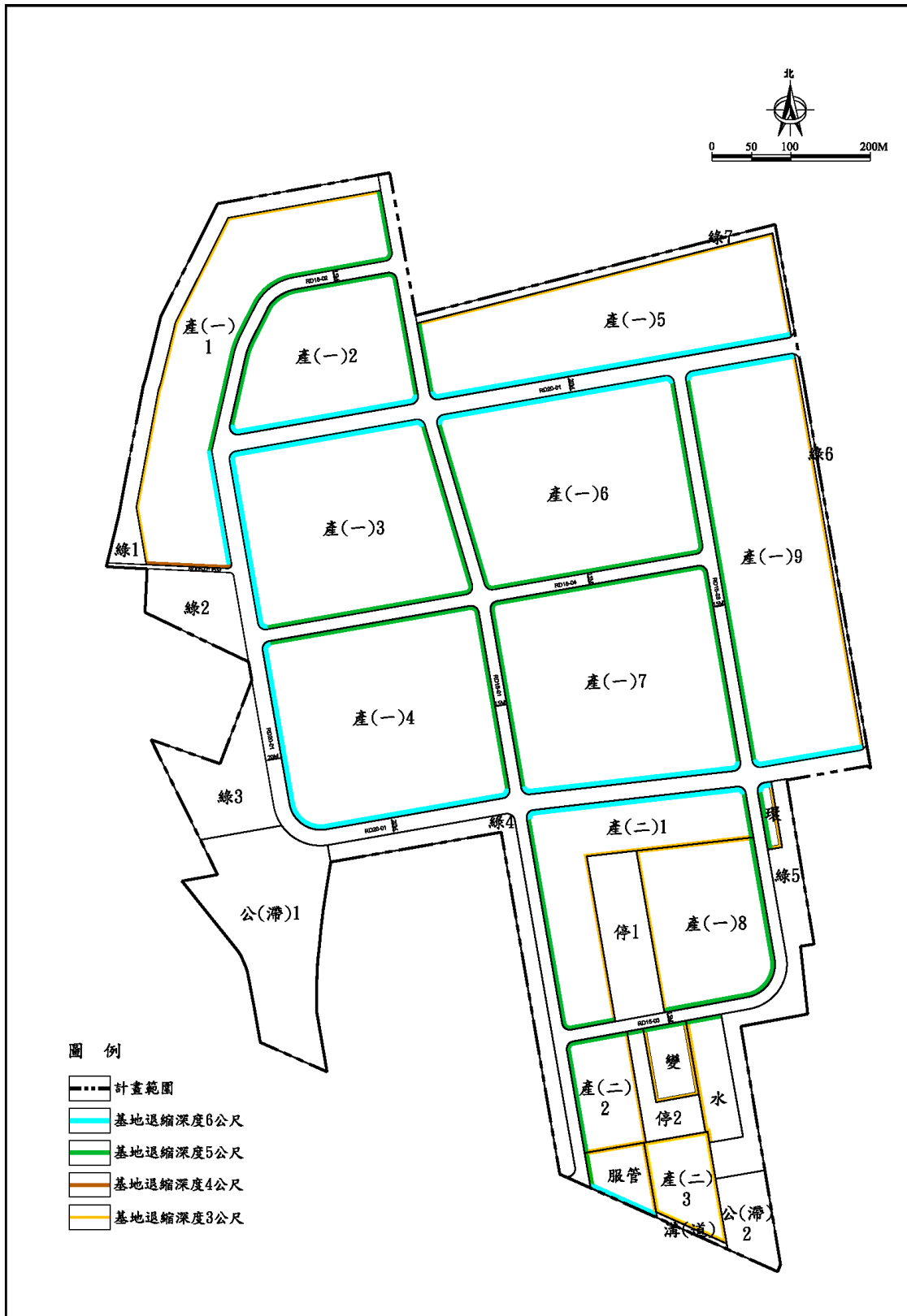


圖 4-3 和春基地退縮範圍示意圖

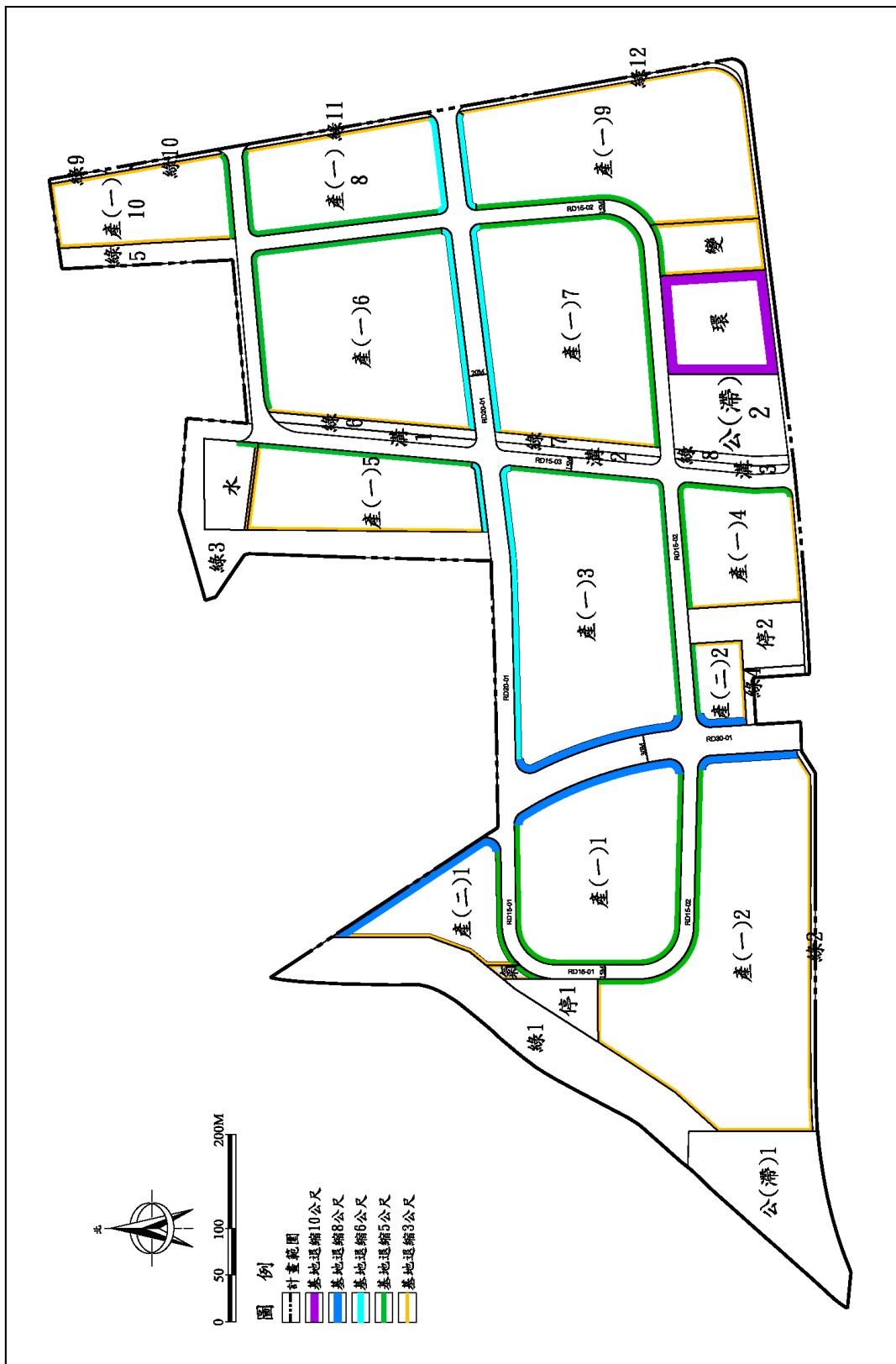


圖 4-4 大發基地退縮範圍示意圖

五、事業及財務計畫

本計畫未涉及事業及財務計畫之變更。

附件一 高雄市政府經濟發展局 111 年 9 月 15 日高市府
經工字第 11135079600 號函

發文方式：紙本遞送

檔 號：

保存年限：

高雄市政府 函

80203
苓雅區四維三路2號

地址：802721高雄市苓雅區四維三路2號
承辦單位：工業輔導科
承辦人：陳亮志
電話：07-3368333#3164
傳真：07-3316309
電子信箱：lcchen@kcg.gov.tw

受文者：本府經濟發展局

發文日期：中華民國111年9月15日

發文字號：高市府經工字第11135079600號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明二、三

裝

主旨：為辦理「變更高雄市大坪頂以東地區都市計畫(和發產業園區)細部計畫(土地使用分區管制)案」，詳如說明，請查照。

說明：

- 一、依據都市計畫法第27條第1項第3款辦理。
- 二、旨案已專簽認定屬配合本市經濟發展需要及重大產業設施開發之案件(詳附件)，請貴局依法定程序辦理後續作業。
- 三、隨文檢送旨案計畫書1份。

訂

正本：高雄市政府都市發展局

副本：本府經濟發展局

線

市長 陳其邁

本案依分層負責規定授權業務主管判發